# 19日本国特許庁(JP)

# ①特許出頭公表

# ⑫公表特許公報(A)

平1-501950

❸公表 平成1年(1989)7月6日

⑤Int.Cl.⁴
C 08 F 10/00

**職別記号** MFG 1.01 庁内整理番号 8319-4 J 審 查 請 求 未請求 予備審查請求 未請求

部門(区分) 3(3)

(全17頁)

**②発明の名称** 触媒、これらの触媒の製法およびこれらの触媒を使用する重合プロセス

②特 顧 昭63-501758

**國型出 顧 昭63(1988) 1月27日** 

8期駅文提出日 昭63(1988)9月22日

**多国際出願 PCT/US88/00222 の国際公開番号 WO88/05792** 

**國際公開日 昭63(1988)8月11日** 

優先権主張 ②1987年1月30日魯米国(US)③011,471 ②1987年12月21日魯米国(US)⑤133,052

@発 明 者 ターナー、ハワード・ウイリア

アメリカ合衆国77598テキサス州ウエブスター、エルダー・グレン

303

**②発明者 ラトキー、グリゴリー・ジョー** 

アメリカ合衆国77062テキサス州ヒユーストン、スペース・センタ

ー・ブールバード 15900、エヌー2

⑪出 顋 人 エクソン・ケミカル・パテン

アメリカ合衆国07036-0710-ユー・ジヤージー州 リンデン、イ

ースト・リンデン・アベニユー 1900

ツ・インク 29代 理 人 弁理士 山崎 行造 外3名

動指 定 国 AU,BR,DK,FI,HU,JP,KR,NO,SU

## 浄徳(内容に変更なし)

特許請求の範題

1. (a) 適した溶媒または粉釈剤中で、プロトンと反応できる最低一つの電換基を含むピス(シクロペンタジェニル)金属化合物から成り、耐記金属がテタニウム、ジルコニウムおよびハフニウムから或る群から選択される最低一つの第一化合物および、プロトンを与えることができるカチオンと、世数の朝米原子を会せ、かき高で不安定で、二化合物間の反応の結果生成する金属カチオンを変定化することができるアニオンとから成る最低一つの第二化合物を一物にし、

- (b) 第二化合物のカチオンによって提供されるプロトンが前記金銭化合物に含まれる前記置換基と反応するのに十分な時間、段階(a) で接触を保持し、
- (c) 股階(b) からの直接生成物として、または1つまたはそれ以上の前記道後生成物の分解度物として、活性触媒を回収する。

消段階から成る、触媒の製法。

前記ピス (シクロペンタジエニル) 金属化合物が次の一般式によってあらわされ!

(A-C<sub>p</sub>) MX<sub>1</sub> X<sub>2</sub> (A-C<sub>p</sub>) MX' ) X' 1 (A-C<sub>p</sub>) MLB' まぴ/またほ (C<sub>a</sub><sup>\*</sup>)(C<sub>a</sub> 和 MX<sub>1</sub>

ここで:

Μはチタニウム(T1)、ジルコニウム(2r)およびハフニ ウム(81)から成る料から選択される金鸝;(A~C。) и (С<sub>р</sub>)(С<sub>р</sub>\*) жанС<sub>р</sub> − А′ − С<sub>р</sub>\*で、С<sub>р</sub> я́ よび C. p t は 関 U'がまたは 異なる 配換また は 来 選 換 の シ クロベンタジェニル基で、任意に2箇の独立的に質換 された、または置換されない薪であり:A′は第Ⅳ-A 族の元素を含む共有結合架構基であり;Lはオレフィ ン、ジオレフィンまたはアリインリガンドである: X 1 およびX 2 はハイドライド益、ヒドロカルピル益、 置換ヒドロカルビル基、任意に2首の低級アルキル 智 塩 基 ま た は 2 質 の ハ イ ドラ イ ド、 有 趣 メ タ ロ イ ド 基準から成る群から独立的に選択され;X′」および X′っは金属原子に結合して金属サイクルを形成し、 ここでは金属、 X′ 1 および X′ 2 は約 3 乃至約 20の 炭素原子を含む炭化水素器を形成し; R は、やはり金 属駅子に結合したシクロペンタジェニル基の一つの上 にある雑典器である

請求項1に記載の方法。

3. 前紀第二化合物が、次の一般式 - (L'-N) {(CX)<sub>a</sub> (BX')<sub>a</sub> X'<sub>b</sub>; <sup>b</sup>

L'ードは日\*、アンモニウムまたは、ヒドロカルビルまたは座換ヒドロカルビル基で置換される3箇までの水常原子をもつ度換アンモニウムは、ホスフォニウム、またはヒドロカルビルまたは環換ヒドロカルビル

送によって電換される3 簡までの水乗原子をもつ電換ホスフォニウム基等であり: B および C はそれぞれ 明常および炭素であり: X、 X、 および X。 はハイドライド基、ハリド基、 上ドロカルビル基、 有機メタロイド基等から成る群から独立的に選ばれる基であり: a および b は ≥ 0 の整数で: c は ≥ 1 の複数; a + b + c = 2 から約8までの例数の数数; m は 5 ~ 約22の範囲の整数である:

および/または

 $\{L^{*} \rightarrow H\} \ \left( \left( C X_{4} \right)_{g'} \left( B X_{4} \right)_{g'} \left( X_{4} \right)_{g'} \right)^{g' - 1} a^{-1} M^{n q} \right)^{d - 1}$ 

227:

ジェニル) ジルコニウム ジメチル、および [1.8-ビス (トリメチルシリル) シクロペンタジェニル] ジルコニ ウム ジメチルから成る群から選択される請求項 8 に記 森の方法。

7. 阿記第二化合物が次の一般式によってあらわまれ: [L'-H] ((CH) <sub>W</sub> (BH) <sub>M</sub> H<sub>bl</sub> ) <sup>v-</sup>

227:

L・一日は日\*、アンモニウムまたは、3 簡までの水 米がヒドロカルビルまたは霊旗とドロカルビル基によって国旗された、任意に三羅旗された医旗アンモニウム なたは 3 簡までの水 米がヒドロカルビル 4 によって 2 競技 もれた 2 選換とドロカルビル 4 によって 3 数 は 4 は 4 は 5 から18までの整数 ; a y は 0 から 3 までの整数 ; a y + b y + c y - 4 ; そして m x は 5 から18までの整数である

路求項1から請求項4までのいずれかに記載の方法。

8. 前記知二化合物がトリ(n-ブテル)アンモニウム 7. N-ジカルパウンデカポレートおよびトリ(n-ブテル)アンモニウムトリデカハイドライド-1- カルパウンデカポレートから成る群から選択され、この場合第一化合物が紆ましくほピス(ペンタメチルンクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメチルであり、かつ/またほし、一日が且\*、より纤まじくほ 7.8-ジカルパウンデカポラン

の中の一つによってあらわされる請求項 1 または請求項 2 に記載の方法。

4. 段階 (a) の接触が約-100で一約 100でまでの範囲の 組度で、好ましくは 0 ~ 45.000px1g ( 0 ~ 28471 ㎏/㎡) の圧力下で行われる先行請求項のいずれかに記載の方法。 5. 本二化合物が一般式

[L, -H] [(CH) " (BH) " cx.

によってあらわされ

227:

し、一日は日\*、アンモニウムまたは、ヒドロカルビルまたは産族ヒドロカルビル誌で協議される3 協までの水常原子をもつ任立に三世娘された変換アンモニウム基、ホスフォニウムまたは、ヒドロカルビルまたは、ヒドロカルビルまたは、ヒドロカルビルまでは後とドロカルビル器で産換される3 協までの水常原子をもつ破換ホスフォニウム基等であり; B、Cおよびおはそれぞれ研索、炭素および水条で; a x は 0 か1 で; c x は 2 か 1 であり; a x - c x - 2; b x は10から12までの要数である。

先行請求項のいずれかに記載の方法。

6. 前記第二化合物がピス【トリ (a-ブチル) アンモニウム】ドデカボレートおよびトリ (a-ブチル) アンモニウム 1-カルバウンデカまたは1-カルバドデカボレートから成る 算から選択され、耐起却一化合物がピス (ペンタメチルシクロベンタジェニル) ジルロニウム ジメチル、、(ベンタメチルシクロベンタジュニル) (シクロベンタ

(18) またはオクタデカボラン(22)であり、この場合任意に前記第一化合物がピス(ベンタメチルシクロベンタジエニル)ジルコニウム ジメチルおよびピス(エチルテトラメチルシクロベンタジスニル)ジルコニウム ジメチルから成る群から選択される請求項 7 に記載の方法。 9、前記第二化合物が次の一般式によってあらわされ!

[L'-H] ((((CH) at (BH) at Had] ct-] + M2 nt+ 1 dt-

ここで:

し、一日は日\*、アンモニウムまたは3箇までの水素原子がヒドロカルビルまたは置換ヒドロカルビルまでは変換に10カルビルまでは3箇までの水素原子がヒドロカルビルまたは置換たは3箇までの水素原子がヒドロカルビルまたは置換された 区換ホスフォニウム 基等であり; B、C、日およびM 2 はそれぞれの表、炭素、水素および通移金属であり; B、Z は 0 から2までの整数; C、Z は 2 か 3; m x は 9 から11までの整数; C、Z は 2 か 3; m x は 9 から11までの整数; A、Z + b z + c z ー 4; n z および d x はそれぞれ 2 と 2、または 3 と 1 である

請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の方法。

10. 前記録二化合物が N. N-ジメ チ ル ア ニ リ ニ ウ ム ビス ( ウン デ カ ハ イ ド ラ イ ド - 7 . 8 - ジ カ ル パ ウ ン デ カ ボ レ ー ト ) コ パ ル テ ー ト ( 豆 ) で あ り 、 か つ ノ ま た は 前 紀 節 一 化 合物 が 1 - ビス ( シ ク ロ ペ ン タ ジ エ ニ ル ) チ タ ン - 8 - ジ メ チ ル レ ラ シ ク ロ ブ タ ン 、 1 - ビ ス ( シ ク ロ ペ ン タ ジ エ ニ

ル) ジルコン-1- ジメチルシラシクロプタン、および1-ビス (シクロペンタジエニル) ハフナー9- ジメチルシラ シクロブタン、ピス (シクロペンタジエニル) ジルコニ ウム (2.8 ジメチル-1.8.-ブタジエン) およびピス (シ クロペンタジエニル) ハフニウム (3.3-ジメチル-1.3-プタジエン)、(ペンタチメルシクロペンチジエニル) (テトラメチルシクロペンタジエニルメチレン) ジルコ ニウムフェニルおよび (ペンタメチルシクロペンタジェ ニル) (テトラメチルシクロペンタジエニルメチレン) ハフニウムペンジルから成る群から選択され;または第 二化合物がN.X-ジメチルアニリニウム ピス(7.8-ジカ ルパウンデカポレート) ニッケレート (丑) および N. N-ジメチルアニリニウム ピス(1.8-ジカルパウンデカボ レート) フェレート (皿) でこの場合好ましくは知一化 合物がピス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジル コニウム ジメチルである請求項9に記載の方法。 11. 2 乃至約18の以米原子を含むローオレフィン、ジオ レフィンおよび/またはアセチレン性不飽和化合物を、 単独で、または1粒類またはそれ以上のモノマーと組み

(a) 約-100でから約 300でまでの範囲内の組皮、約 0 から約 45.000psig (0 - 18471 kg/cd) の範囲内の圧力で、オレフィン、ジオレフィンおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーを、単独で、または 1 種類かそれ以上のモノマーと組み合わせて適当な担体、搭載または

希釈剤中で、先行請求項のいずれかに記載の方法によって、あらかじめ製造した、或いはその場で製造した触銘と、食合の間接触させ、

- (b) 散階(a) の復独を少くとも上記オレフィンの一部が負合するのに十分な時間複雑し;
- (c) ポリマー生成物を回収する 股階から成る銀合方法。
- 12. 請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の方法により認識される触媒。
- 18. 靖求項11の方法にしたがって製造されるポリオレフィン。
- 14. 次の一般式
  - (A-C\_) MX; B'
- によってあらわきれ、

ここで:M はチタニウム (T1)、ジルコニウム  $(Z_T)$  および

ハフニウム ( $\|f$ )から成る群から選択される金属で; ( $A-C_p$ ) は ( $C_p$ ) ( $C_p^*$ ) または $C_p-A'-C_p^*$ で、  $C_p$  と  $C_p^*$ は同じかまたは異なる複換ーまたは未能換のシクロペンタジェニル基で;A' は第V-A 扱元業を含む共有結合架核基であり; $X_1$  はハイドライド基、ヒドロカルビル基、有機メクロイド基等から成る群から選択され、B' は次の一般式

((CX) \_ (8 X′) \_ X′ <sub>b</sub>) <sup>e-</sup> ここで:

B および C はそれぞれ 初来および放衆:

合わせて、重合する方法であって、

X。 X がおよび X がはいイドライド茲、ハリド茲、ヒドロカルビル茲、有限メタロイド茲等から成る群から独立的に選択される益で:

- a および b は ≥ 0 の 整致で; c は ≥ 1 の 数数;
- a+b+cは2から約8までの俱数の整数;
- m はちから約22までの転回の整数;および84 (((CX1) g' (8X4) g' (X1) g' ) g m j g m

ここで:

B、 C および M はそれぞれ 間常、 炭素および 選抄 金属:
X 1 、 X 4 および X 1 はハイドライド 基 、ハリド 越、
ヒドロカルビル 基 、 有機 メタロイド 基 等から 成る 群から 独立的に 選択 きれ; A 7 および b 7 は同じ か 異なる
≥ 0 の 整数: C 7 は ≥ 2 の 整数; a 7 + b 7 + c 7 は
4 から 約 8 までの 偶数の 整数: m 7 は 5 から約 12まで
の 整数: n は 2 c 7 .- n = d となるような 整数; d は
≥ 1 の 整数で ある:

のうちの一つの式によってあらわされる適合性非配位 性アニオンである

化合物を含む物質組成物。

16. (A - C p ) がピス (ベルアルキル置換 -シクロベンタジエニル) で、 X がアルキル基で; B ′ が (ドヂカハイドリド-7.8- ジカルバウンデカボレート) で、 M がジルコニウムであり、ベルアルキル関独シクロベンタジエニル基の各アルキルはが独立的に C 1 - C 20アルキル

薪で、アルキル群は C 1 − C 20 アルキル基で、ベルアルキル関係基は好きしくはベンタメチルまたはエチルチトラメチルで、アルキル基は好きしくはメチル基である跡次項14に延載の物質組成物。

## 明 田 書

触媒、これらの触媒の製造およびこれらの触媒を使用する重合プロセス

これは1987年1月80日提出の米国特許出願第011.471 号の一部総統出題である。

## 発明の背景

本発明は、触媒として有用な物質組成物、これら触線の製法、これら物質組成物を触縁として使用するプロセス、およびこれら触媒で製造される量合生成物に関するものである。より詳細に述べるならば、本発明は、触媒組成物、この触媒組成物の製法、これら触媒組成物を用いてオレフィン、ジオレフィンおよび/またはアセチレン性不給和モノマーを量合する方法、およびこれらの触線組成物で製造される最合生成物に関するものである。

オレフィン盤合における可溶性チーグラーーナッタ触
はの使用は先行技術ではもちろんよく知られている。 既してこれらの可溶性系は第N-B該金属化合物および金属 アルキル助触線、特にアルミニウムアルキル助触線を含む。これらの触線の整種は、第N-B該金属、物とテクニウムアルキル助触線を含む。ではス(シクロペンタジェニル) 化合物とアルミニウムアルキル助触線とから成る整理である。可修性チーグラーーナッタ型オレフィン質合触線のこの整理における活性触線複の実際の構造に関しては推測の場を出ていが、版して活性触線程は、不安定な安定アニオンの分解でオレフィンをアルキル化するイオンまたはその分解

盛物であるという考え方が容認されているようにみえ る。 この理論はプレスロウ(Breslov) およびニュウバ ーグ(Nevburg) 、およびロング(Long)およびプレスロウ によって最初に提唱され、J.Am.Chem.Soc.,1959,81巻、 81-86 ページお上びJ.As.Chem.Soc..1960.82巻、1958-1957ページの彼等の論文中に記されている。彼等の論文 に記されているように、罹々の研究は、その恐性特性研 はテタニウムアルキル錯化合物であるか、または、テタ ニウム化合物すなわちピス(シクロペンタジェニル) チタニウムジハリド、およびアルミニウムアルギル が触媒または触媒前駆体として用いられるときそれら (チタニウムアルキル粒化合物)から誘導される種類 であることを示唆した。チタニウム化合物が用いられ るときイオンが存在するーすべては平衡状態でーこと は、ディアチコヴスキー(Dyachkovskii)、VysoEosol. Soyed..1985.7 巻114-118 ページおよびディアチョヴ スキー、シロヴァ(Shilova) およびシロヴ(Shilov)、J. Polya.Sci., Part C. 1987, 2888-2888によっても示唆され た。チタニウム化合物を用いる場合、活性触媒程がカチ オン鎖化合物であることは、その後アイシュ(Elach) 基 (J. An. Chem. Soc. 1985.107 磁 .7219-7221ページ) も示唆 Lt.

先行論文は、活性触媒程がイオン対、特に食腐成分が カチオンまたはその分類度物として存在しているイオン 対であることを数示または示唆し、これらの文献はこの

ような活性触媒種を形成する配位化学を飲用または呆瞭 している一方、これらの論文のすべては、ルュイス酸を 含む助触媒を使用して活性イオン性触媒類を形成または 安定化することを数示している。活性触媒は明らかに二 つの中性成分 (メタロセンおよびアルミニウムアルキル) のルェイス酸ールェイス塩基反応によって形成され、中 性の、見たところ不活性のアダクトと、イオン対ー多分 活性触媒ーとの間を平衡させる。この平衡の結果として、 存在して無性カチオン純媒類を安定させているにちがい ないアニオンに対して競争がある。もちろんこの平衡は 可逆的であり、このような逆転は触媒を不活性化するで あろう。その上、今までに考えられた触媒系は、系に塩 基性不純物があると毒性作用にまらされる。さらに、可 推性チーグラーーナック触媒系に使用するためにこれま で考えられたルュイス酸の一金でと言わないまでも一多 くは連載移動剤であり、その結果、生成ポリマーの分子 量および生成物分子並分布の効果的コントロールを知止 する。その上、これまで考えられた助触媒の全てと登わ ないまでも大部分は高度に自然発火性であり、その結果 その使用はいくらか危険である。

上記の放排系は、使用する第N-3族金属がジルコニウムまたはハフニウムである場合は低して、特に括性ではない。しかしながら最近、ピス(シクロベンタジエニル)ジルコニウムおよびピス(シクロベンタジエニル)ジルコニウム化合物をアルモキサンと共に用いるとき、活性

チーグラー・ナック的ほが形成されることが発見された。 よく知られているように、これらの耳はいくつかの知ら かな兵所をもっている。それらの長所としては、上記の ピス(シクロペンタジエニル)チタニウム触媒より若し く高い触媒活性および従来のチーグラーーナッタ触媒に よる場合に比べてより狭い分子量分布をもったポリマー の製造である。しかしながらこれらの系は、均非性不納 物が存在するときには相変らず森性作用を受け、効率的 に提能するためには、望ましくない程過剰のアルモキサ ンを必要とする。その上ハフニウム合有系は、少くとも ホモ賃合のために用いる場合は、ジルコニウム会有系は と無性ではない。このことはギアネッチ(Gianaetti) . ニコレッチ(Wicoletti) およびマソッチー(Wazzocchi)、 J.Polya.Sci.Polya.Chem.1925.28巻 2117-2138ページ、 によって示唆された。仗等は、ピス(シクロペンタジェ ニル)ハフニウム化合物のエチレン食合速度が、類似の ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム化合物のそ れよりも5~10倍もおそい一方、生成したポリエチレン の分子兼には、二触媒関でほとんど豊かなかった、と主 報した。

これまでに考えられた配位 触線系のいくつかの 欠点に限らして、 (1) 分子盤および分子量分布をより良くコントロールでき; (2) 活性化平衡にきらされず; (1) 不都合な助触線の使用を含まない、改良された配位系の必要性が明白であると考えられる。

#### 発明の概要

本発明のイオン性触媒、およびこれと共に提供される 改良されたオレフィン、ジオレフィンおよび/またはア セチレン性不能和モノマー重合プロセスを用いれば、先 行技術のイオン性オレフィン国合触媒の前述の、および その他の久点は避けられるか、または少くとも減少する ことが発見された。そこで本苑明の目的は、オレフィン、 ジオレフィンおよびアセチレン性不能和モノマーの立合 に有用な改良されたイオン触媒系を提供することである。 本発明の他の目的はこのような改良触媒の配法を提供す ることである。本苑明のもう一つの目的はこのような改 良触媒を用いる改良理合プロセスを提供することである。 本発明の別の目的は、イオン平衡逆転を受けない改良さ れた触媒を提供することである。本発明のまた別の目的 は、生成物ポリマーの分子量および分子量分布をより良 くコントロールすることのできる改良触媒を提供するこ とである。本発明のもう一つの目的は、使用時に発火の 危険性がより少ない改良触媒を提供することである。本 発明のさらにもう一つの目的は、比較的狭い分子並分布 をもち、或る程の金属不能物を含まない。これら改良触 媒を用いて製造される豊合生成物を提供することである。 本発明の上記のおよびその他の目的および利点は、この 後に示される説明およびここに含まれる実施例から明ら

本売明にしたかうと、前途のおよびその他の目的およ

しかしながらそのアニオンは、エチレンで電換されるほど十分には不安定でない。

# 発明の詳細な説明

前途のように、本発明は触媒、そのような触媒の観法、 そのような触媒の使用法およびそのような触媒で製造さ れる重合生成物に関するものである。その触媒はαーオ レフィン、ジオレフィンおよびアセチレン佐不飽和モノ マーの重合において特に有用である。改良触媒は、形式 上記位数3 および原子毎+4を有するカチオンを形成する ことができる元素周期売算TV-R排金屋のピス(シクロペ ンタジエニル)議選はである最低一つの領一化会物と、 プロトンを供与することができるカチオン並びに復数の 研索原子を含む適合性の非配位アニオンであって、かさ が大きく、不安定で、第IV-B終金属カテオンまたはその 分解車物の、aーオレフィン、ジオレフィンおよび/ま たはアセチレン性不飽和モノマーを宣合する能力を担害 することなく第 IV-B接金国カチオンを安定し得るアニオ ンから成る最低一つの第二化合物とを結合することによ ってつくられる。

本明細書中の元業周期表に関するすべての参照はCRC プレス社 (CRC Press.lac.)が1984年に出版し、著作権を とった元業周期表を参解している。またそのような元素 周期表の数(一つまたは複数)のあらゆる参照は、この 元素周期表にあらわされている族(一つまたは複数)を 参照している。

び長所は最低二つの成分を組み合わせてつくられる触媒 で、およびそれを用いることによって達成される。この 成分の中部一は、ルュイスーまたはブレンステッド群と 結合し、それによって前N-B放金貨カチオンを与える最 低一つのリガンドを含む可溶性、ピス(シクロベンタ ジエニル)-闡換-第『V-B族企真化合物であり、第二の 化会物は、プロトンを与え上記簿N-B版金額化合物の 上記リガンドと非可逆的に反応して遊離の中性脳密物 を遊離するカチオンと、複数の弱素原子を含む適合性 (Compatible)の非配位アニオンとから成る。この第合性 非配位アニオンは安定で、かさ高で、かつ不安定である。 可接性第 IV-B族食腐化合物は、上記リガンドがそれから 遊離するとき、正式には配位数3および原子紙+4を有す るカチオンを形成することができなければならない。故 二の化合物のアニオンは、第 IV -B族会議カチオンまたは その分解虚物の触媒として機能する能力を阻害すること なく解IV-B鉄金属カチオン錯化合物を安定することがで きなければならないし、重合中にオンフィン、ジオレフ ィンまたはアセチレン性不飽和モノマーによる関係が可 旋なほど不安定でなければならない。たとえばポックマ ン (Bockmann)およびウィルソン (Yilson)は、ピス (シク ロベンタジエニル) ーチタニウムジメチルはテトラフル オロ朝駛と反応してピス(シクロペンタジェニル)チタ ニウムメチルテトラフルオロ初散を形成する、と報告し た (J.Ches.Soc.Chem.Coss..1980.1610-1811 ページ) .

本明和省に用いられている用語・適合性非配位性アニオン・は、上記カチオンに配位しないかなたは上記カチオンに配位しないが基によって単独されるほど十分不安定のままであるアニオンを意味が良いて安定アニオンとしてはたらくと言に、アニオン性配換をまたはその断片を上記カチオンに移すことによって中性の四配位メタロセンおよび中性明素制度物を形成することのないアニオンを得に指す。適合性アニオンとは、最初に形成された増化含物が分解するとき、中性までは分解しないアニオンである。

本発明の改良触ばの第一化合物として有用な第 IV - B族 金属化合物、特にチタニウム- 、 ジルコニウム- および ハフニウム化合物は、チタニウム、 ジルコニウム および ハフニウムのピス (シクロペンタ ジェニル) 誘導体であ る。ほして有用なチタニウム- 、 ジルコニウム- および ハフニウム化合物は、次の一般式によってあらわまれる:

- 1. (A-C, ) MX; X:
- 2. (A-C ) MX' , X'
- 1. (A-C, ) ML
- 4. ເຊິ່ງເຊັສົມແ<sub>ຂ</sub>ຸ

## 特表平1-501950(6)

永麗镇シクロベンタジュニル基で、ここでA' は第1V-A 族元素を含む共有結合類編型(bridging group)でありし はオレフィン、ジオレフィンまたはアリイン(aryne) リ ガンドである: X 、および X 。はハイドライド基、1 ~ 約28の食金菓子を有するヒドロカルビル基、1百または それ以上の水素原子がハロゲン原子によって置換され 1~約20の災素原子を有する置換ヒドロカルビル基、 第 IV-A版元素を含む有機メタロイド基であって有機メ タロイドの有機部分に含まれるヒドロカルピン個換 我の名々が独立的に1~約20篇の炭素原子を含む有機 メタロイド基等から成る群から独立的に選択され; X' i およびX' g は金属原子に結合して金属サイクル (setalizeycle) を形成し、そこでは金属、X' ; およ び X ′ , は約3~約20の炭素原子を含む炭化水素調モ形 <u>成する:Rは、これもまた金属原子に結合しているシク</u> ロベンタジエニル基の一つに 1 ~約20の鉄業原子を育す る世族誌、より好ましくはヒドロカルビル屋換益である。

シクロペンタジェニル基の各族素源子は独立的に、関係されていないかもしくは、ヒドロカルビルは、1 簡またはそれ以上の水素原子がハロゲン原子によって関係された関係ヒドロカルビル基、メタロイドが元紫周別表の類で-A版から選択されるヒドロカルビル関係メタロイド 基、ハロゲン基等から成る群から選択される同一のまたは異なる基である。シクロペンタジェニル基の最低1 簡の水素原子が関係されるのに適当なヒドロカルビルおよ

び置換とドロカルビル基は1~約20の改衆原子を含み、置数一および分技アルキル基、短状炭化水素基、アルキル 関数環状炭化水素基、芳智族基 およびアルキル は 次 芳智族 基 および アルキル は 次 方 智族 基 および アルキル は 次 方 智族 基 および アルキル は 次 から と ドロカルビル ま た は 正 旗 と ドロカルビル ま た な 正 旗 と ドロカルビル ま た な で かん と い な な かっと ドロカルビル は な アルキル は な アルキル は な アルキル と で な な と ドロカル ビル は な アルキル と で な な で あ ら。 適 し た 有 機 メ タロイド 基 か あ ら。 適 し た 有 機 メ タロイド 基 か あ り、ここで と ドロカル ビル 基 の そ な は 1 ~ 約 20の 炭 衆 原子を含む。 適 し た 有 機 メ タロイド 基 か あ り、ここで と ドロカル ビル ま の そ ドロ は 1 ~ 約 20の 炭 衆 原子を含む。 適 し た 有 機 メ タロイド 基 か あ り、ここで と ド ロカル ビル ス チャルシリル、トリメ チルシリル、トリエチル ジャル シリル、トリメ チル ゲル ミルマ か ある。

本発明の改良触線の設造に用いられるピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム化合物の例証的だが制限的でない例は、ジヒドロカルビル置換ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメチル、ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジブロビル、ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジブテル、ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジブテル、ピス(シス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジフェニル、ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジネオペ

ンチル、ピス (シクロペンタジエニル) ジルコニウム ジ (a-) リル) 、ピス (シクロペンタジエニル) ジルコ ニウム ジ (o-トリル) 等 : (モノヒドロカルビルー国 推シクロペンタジエニル)ジルコニウム化合物、たとえ ぱ(メチルシクロペンタジエエル)(シクロペンタジエ ニル) およびピス(メチルシクロペンタジエニル)ジル コニウム ジメチル、 (エチルシクロベンタジエニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (エチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、(プロビルシ クロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) および ピス (プロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、(n-ブチルシクロペンタジエニル)(シクロ ペンタジェニル) およびピス (a~ブチルシクロペンタジ エニル) ジルコニウム ジメチル、(1-ブチルシクロペ ンタジエニル) (シクロベンタジエニル)およびピス (モープチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメ チル、(シクロヘキシルメチルシクロベンタジエニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (シクロヘキシル メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、 (ペンジルシクロペンタジエニル)・(シクロペンタジエ ニル) およびピス (ペンジルシクロペンタジエニル) ジ ルコニウム ジメチル、(ジフエニルメチルシクロペン タジエニル) (シクロペンタジエニル)およびピス(グ フェニルメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、(メチルシクロペンタジエニル)(シクロペ

ンタジェニル) およびピス (メチルシクロペンタジエニ ル)ジルコニウムニ水業化物、(エチルシクロベンタジ エニル)(シクロペンタジエニル)およびピス(エチル シクロベンタジエニル)ジルコニウム二水素化物、(ブ ロビルシクロペンタジェニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (プロピルシクロペンタジエニル) ジルコ ニゥムニ水業化物、(a-ブチルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (n-ブチルシクロ ペンタジエニル)ジルコニウム二水素化物、(いブチル シクロベンタジェニル) (シクロベンタジエニル) およ びピス(ヒープチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム 二水素化物、(シクロヘキシルメチルシクロペンタジェ ニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (シクロヘ キシルメチルシタロペンタジエニル)ジルコニウム二水 素化物、(ベングルシクロベンタジエエル)(シクロベ ンタジェニル) およびピス (ペンジルシクロペンタジエ ニル)ジルコニウム二水果化物、(ジフェニルメチルシ クロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) および ピス (ジフェニルメチルシクロペンえジエニル) ジルコ ニウムニ水会化物等:(ボリヒドロカルビル電機・シク ロペンタジエニル)ジルコニウム化合物、たとえば(ジ メチルシクロペンタジェニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニ ウム ジメチル、(トリメチルシクロペンタジエニル) (シクロベンタジエニル) およびピス (トリメチルシク

ロベンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、(テトラ メチルシクロベンタジエニル) (シクロベンタジエニル) およびピス(チトラメチルシクロペンタジェニル)ジル コニウム ジメチル、 (ペルメチルシクロペンクジェニ ル)(シクロベンタジエニル)およびピス(ベルメチル シクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、 (エ チルチトラメチルシクロペンタジエニル) (シクロペン タジエニル) およびピス (エチルテトラメチルシクロベ ンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、 (インデニル) (シクロペンタジエニル)およびピス(インデニル)ジ ルコニウム ジメチル、(ジメチルシクロベンタジェニ ル) (シクロベンタジエニル)およびヒス(ジメチルシ クロペンタジエニル)ジルコニウム二水気化物、(トリ メチルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジェニル) およびピス (トリメチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムニ水楽化物、(テトラメチルシクロペンタジェニ ル)(シクロペンタジエニル)およびピス(テトラメチ ルシクロペンタジエニル)ジルコニウム二水塩化物。 (ベルメチルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジ エニル) およびピス (ペルメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム二水栄化物、(エチルテトラメチルシクロ ペンタジエニル) (シクロペンタジエニル)およびヒス (エチルテトラメチルシクロペンタジエエル) ジルコニ ウムニ水常化物、(インデニル)(シクロベンタジェニ ル)およびピス(インダニル)グルコニウム二水素化物

等;(金属ヒドロカルビルー置換シクロベンタジェニル) ジルコニウム化合物、たとえば(トリメチルシリルシク ロベンタジエニル) (シクロベンタジェニル) およびピ ス(トリメチルシリルシクロベンタジエニル) ジルコニ ウム ジメチル、(トリメチルゲルミルシクロベンタジ ェニル)(シクロペンタジエニル)およびピス(トリメ チルゲルミルシクロベンタジエニル) ジルコニウム ジ メチル、(トリメチル鎖シクロペンタジエニル) (シク ロベンタジエニル) およびピス (トリメチル銀シクロベ ンタジエニル) ジルコニカム ジメチル、(トリメチル 鉛シクロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) お よびピス(トリメチル鉛シクロペンタジエニル)ジルコ ニウム ジメチル、(トリメチルシリルシクロペンタジ エニル)(シクロペンタジエニル)およびピス(トリメ チルシリルシクロベンタジエニル)ジルコニウム二水素 化物、(トリメチルゲルミルシクロベンタジェニル) (シクロベンタジエニル)およびピス(トリメチルゲル ミルシクロペンタジエニル)ジルコニウム二水黒化物。 (トリメチル望シクロペンタジエニル) (シクロペンタ ジエニル) およびピス (トリメチル錫 シクロペンタジェ ニル)グルコニウムニ水常化物、(トリメチル組シクロ ペンタジエニル (シクロペンタジエニル) およびヒス (トリメチル鉛シクロペンタジエニル) ジルコニウムニ 水業化物等;(ハロゲン世級-シクロベンタジェニル) ジルコニウム化合物、たとえば(トリフルオロメチルシ

クロペンタジエニル) (シクロペンタジュニル) および ピス (トリフルオロメチルシクロペンタジェニル) ジル コニウム ジメチル、(トリフルオロメチルシクロペン タジエニル) (シクロペンタジエニル) およびピス (ト リフルオロメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム 二水素化物等:珪素星換-ピス(シクロペンタジェエル) ジルコニウム化合物、たとえばピス(シクロベンタジェ ニル) (トリメチルシリル) (メチル) ジルコニウム、 ピス (シクロペンタジエニル) (トリフェニルシリル) (メチル) ジルコニウム、ピス (シクロベンタジエニル) 【トリス(ジメチルシリル)シリル)(メチル)ジルコ ニウム、ピス (シクロペンタジエニル) 「ピス (メシチ ル) シリル] (メチル) ジルコニウム、ピス (シクロベ ンタジエニル)(トリメチルシリル)(トリメチルシリ ルメチル) ジルコニウム、ピス (シクロペンタジエニル) (トリメチルシリル) (ペンジル) 等;(知路-シクロ ペンタジエニル)ジルコニウム化合物、たとえばメチレ ンーピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメ テル、エテレンーピス(シクロペンタジエニル) ジルコ ニウム ジメチル、ジメチルシリルーピス (シクロペン タジエニル) ジルコニウム ジメチルメチレンービス (シクロベンタジエニル) ジルコニウム二水炭化物、エ チレンーピス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムニ 水素化物、ジメチルシリルーピス(シクロペンタジェニ ル)ジルコニウム二水素化物等;ジルコナサイクル、た

とえばピス(ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジル コナ シクロプタン、ビス (ペンタメチルシクロペンタ ジエニル) ジルコナーシクロベンタン、ピス(シクロベ ンタンジエニル)ジルコナインダン等;オレフィン、 ジオレフィンおよびアリイン (aryoe) リガンド置換ビス (シクロペンタジエニル)ジルコニウム化合物、たとえ ばピス(シクロペンタジエニル)(1.8-プタジエン)ジ ルコニウム、ピス(シクロベンタジェニル)(2.3-ジェ チルー1.8- ブタジエン) ジルコニウム、ピス(ペンタメ チルシクロベンタジエニル) (ベンジン) ジルコニウム 毎:(ヒドロカルビル)(ハイドライド)ピス(シク ロベンタジエニル)ジルコニウム化合物、たとえばピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム (フェニル)(ハイドライド)、ピス(ベンタメチルシ クロベンタジエニル) ジルコニウム (メチル) (ハイド ライド)等;およびシクロペンタジエニル基上の置換基 が金属に結合しているピス(シクロペンタジエニル)ジ ルコニウム化合物、たとえば(ペンタメチルシクロペン タジエニル) (テトラメチルシクロペンタジエニルメチ レン)ジルコニウム水素化物、(ベンタメチルシクロベ ンタジエニル)(テトラメチルシクロペンタジエニルメ チレン)グルコニウム フェニル等である。

辨証的ピス (シクロペンタジェニル) ハフニウムおよびピス (シクロペンタジェニル) チタニウム化合物の間様なリストを作ることはできたが、そのリストは、ピス

(シクロペンタジエニル) ジルコニウム化合物に関して 示したリストとほとんど同じであるから、そのような理 ストは完全な関示には必要ないと思われる。しかし熱理 せる当業者は、上記のいくつかのピス(シクロペンクジ エニル)ジルコニウム化合物に相当するピス(シクロペンクジエニル)ハフニウム化合物は知られていないないないないないないないないないないないないないないではからの化合物のリスト は少なくなるであろう。本発明の触ば組成物に有用なその他のピス(シクロペンクジエニル)ハフニウム化合物は組成物に有用なその他のピス(シクロペンクジエニル)チタニウム化合物、並びにその他のピス(シクロペンクジエニル) ジルコニウム化合物は無線せる当業者には勿論明らかで ある。

本発明の触ばの製造において第二の成分として有用な化合物は、プロトンを供与することのできるブレンステッド酸であるカチオンと、複数の研索原子を含み、比較的大きく、二成分を組み合わせたとき生成する活性触ばり大きく、二成分を組み合わせたとき生成するとから改進合性アニオンは、オレフィン・、ジオレフィン・およびアセチレン性不飽和蒸質或いはその他の中性ルェイス塩基、たとえばエーテル、ニトリル等によって置換されるほど十分に不安定である。紙して、本発明の触ばの製造において有用な第二の化合物であってもよい」

ル基、または1回以上の水素原子がハロゲン原子によっ て優強された、1~約20匹までの炭素以子を含む罹衛と ドロカルビル基によって冒張された冒張アンモニウム茲、 ホスフォニウム基、3日までの水土原子が、1~約20位 の炭素原子を含むヒドロカルビル基で、または1箇以下 の水素原子がハロゲン原子によって登扱された、1~約 20年の以来原子を含む異独ヒドロカルビル基で単独まれ た屋換ホスフォニウム益等のいづれかである:B、C、 M、Hはそれぞれ、暖素、炭素、亜移金属および水業で ある:Xa、X。、X。はハイドライド基、ハリド茲、 1~約20個の炭素原子を育するヒドロカルビル基、 1位 以上の水素原子がハロゲン原子によって製造され、1~ 約20歳の炭素原子を含む置換ヒドロカルビル基、有機メ クロイドの有機部分の各ヒドロカルビル関係基が1~約 20首の炭素原子を含み、金属が元素周期表の質N-k能か ら遊ばれる有機メクロイド基等から或る群から独立的に 選択される葉である: a ′ および b ′ は≥ Q の同じか異 なる難数である; c′ は至2の整数; a′ + b′ + c′ は4から約8までの気数の整数である: m' は6から約 18までの整数: n は 2 c′-n - d となるような整数で、 dは≥1の整数である。

本発明の触媒組成物の第二の成分として用いられる第二化合物の例証的な、だが非制限的な例は、アンモニウム塩、たとえばアンモニウムi-カルバドデカボレート(carbadodecaborate) (以下に列挙するアンモニウムカ

5. (L' -H) ( (CX) (BX' ) X' ) 0" ここで、L^-HはH^、アンモニウムまたは、3條ま での水米原子が1~約20頃の炭米原子を含むヒドロカル ビル益、または10以上の水米原子がハロゲン原子によ って羅換された、1~約20額までの最数原子を含む雑物 ヒドロカルビル基によって保護された関係アンモニウム カチオン、ホスフォニウム基、3 質までの水光似子が1 ~約20箇の政業原子を含むヒドロカルビル基で、または 1 間以上の水米原子がハロゲン原子によって破換された。 1~約20首の政策双子を含む資換ヒドロカルビル基で数 換された塑換ホスフォニウム茲等のいづれかである;B およびCはそれぞれ朝業および以界である;X、X′お よびX \* は、ハイドライド基、ハリド基、1 ~ 約20首の **以来原子を含むヒドロカルビル基、1個以上の水金原子** がハロゲン原子によって置換された、1~約20箇の災業 原子を含む筐換ヒドロカルビル並、有機部分の各ヒドロ カルビル選換基が1~約20個の皮索原子を含み企蹊が元 常用期数の類Ⅳ-A級から選ばれる有限メクロイド基等か ら成る群から独立的に選択される基やである;aおよび bは≥の整数である; Cは≥1の整数である; a+b+ c は 2 から約 8 までの例数の整数である;m は 5 から約 22までの姓放である。

6. [L'-H][[[(CX<sub>1</sub>)]<sub>1</sub>'(BX<sub>1</sub>)]<sub>1</sub>'(X<sub>1</sub>)<sub>1</sub>')<sup>1</sup> - ]<sub>1</sub> M<sup>P</sup>] <sup>6</sup> ここで、 L' - Hは H' 、 アンモニウムまたは 3 抽までの水業原子が 1 ~約 20位の 東奈原子を含むヒドロカルビ

チオンのための例証的だが非制限的の対向イオンとして 1-カルパドデカポレートを用いる):モノヒドロカルビ ル監換アンモニウム塩、たとえばメチルアルモニウム1-カルバドデカポレート、エチルアンモニウム1-カルバド デカポレート、プロピルアンモニウム1-カルバドデカボ レート、インプロピルアンモニウム1-カルバドデカボレ ート、(a-ブチル)アンモニウム L-カルバドデカポレー ト、アニリニウム1-カルバドデカボレート、 (p-トリル) アンモニウム 1-カルパドデカポレート等:ジヒドロカル ビル製換アンモニウム塩、たとえばジメチルアンモニウ ム1-カルバドデカボレート、ジエチルアンモニウム1-カ ルバドデカポレート、ジプロピルアンモニウム1-カルバ ドデカポレート、ジイソプロピルアンモニウム1-カルバ ドデカポレート、ジ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバ ドデカポレート、ジフェニルアンモニウム(-カルバドデ カポレート、グ ( p^トリル) アンモニウム1-カルバドデ カポレート等:トリヒドロカルビルー管性アンモニウム 塩、たとえばトリメチルアンモニウム]-カルパドデカポ レート、トリエチルアンモニウム1-カルパドデカポレー ト、トリプロピルアンモニウム1-カルバドデカボレート、 トリ (a-ブテル) アンモニウム1-カルバドデカポレート、 トリフェニルアンモニウム1-カルバドデカポレート、ド リ (p-トリル) アンモニウム:-カルパドデカポレート、 N. N-ジメテルアニリウム 1-カルバドデカボレート、N. N-ジェチルアニリニウム1-カルパドデカボレート答である。

式もに相当する第二化合物の例証的だが制限的でない 供は「以下に列挙するアニオンの例紙的だが制限的でな い対向イオンとしてトリ(n-ブチン)アンモニウムを川 いる】、アニオンの塩、たとえばピス【トリ (a-ブチル) アンモニウム] ノナポレート、ピス [トリ (n-ブチル) アンモニウム】ゲカボレート、ピス【トリ(n-プチル) アンモニカム】ウンデカポレート、ピス【トリ(n-ブチ ル) アンモニウム] ドデカポレート、ピス [トリ (a-ブ チル) アンモニウム] デカクロロデカポレート、ビス 【トリ (n-ブチル) アンモニウム】ドデカクロロドデカ ポレート、トリ (p-プチル) アンモニウムi-カルパデカ ボレート、トリ(n-プテル)アンモニウム1-カルパウン デカポレート、ト·リ (n-ブチル) アンモニウム1-カルバ ドデカポレート、トリ (n-ブチル) アンモニウム1-トリ メチルシリル -1-カルパデカポレート、トリ(a-ブチル)/ アンモニウム ジプロモ -1-カルバドデカボレート等; ボランおよびカルボラン館化合物およびボランおよびカ ルポランアニオンの塩、たとえばデカポラン(14)、7.8-ジカルバウンデカポラン(18)、2.7-ジカルバウンデカポ ラン (11)、ウンデカハイドライド -7.1-ジメチル-7.1-ジカルパウンデカポラン、ドデカハイドライド-11-メチ ル -2.7-ジカルパウンデカポラン、トリ (n-ブチル) ア ンモニウムウンデカポレート(14)、トリ (n-ブチル) ァ ンモニウム B-カルパデカポレート (12)、トリ (n-プチル) アンモニウム 7 ーカルパウンデカポレート(13)、トリ

(ロープチル) アンモニウム 1. ま-ジカルバウンデカポレー ト (II)、トリ (a-ブチル) アンモニウム 2.8-ジカルパウ ンデカポレート(11)、トリ(n-プチル)アンモニウムド デカハイドライド -8-メチル1.9-ジカルパウンデカポレ ート、トリ (a-プチル) アンモニウム ウンデカハイド ライド 8-エチル -7.8-ジカルパウンデカポレート、トリ (4-ブテル)アンモニウム ウンデカハイドライド -8-プチル -7.8-ジカルパウンデカポレート、トリ(ロープチ ル)アンモニウムウンデカハイドライド -8-アリル -1。 8-ジカルパウンデカポレート、トリ (n-プチル) アンモ ニウムウンデカハイドライド -8-トリメテルシリル -1. オーシ゚カルパウンヂカポレート、トリ (a-ブチル) アンモ ニウム ウンデカハイドライド -4.8-ジプロモ -1-カル パウンデカポレート等:ポランおよびカルポランおよび ポランおよびカルポランの塩、たとえば4-カルパノナポ ラン(14)、1.3-ジカルパノナポラン(13)、8.4-ジカルバ デカポラン(14)、ドデカハイドライド -1-フェニル -1, 3-ジカルパノナポラン、ドデカハイドライド -1-メチル -1.3- ジカルパノナポラン、ウンデカハイドライド -1. 3-ジメテル -1.8-ジカルパノナポラン等。

式 8 にしたがう第二の化合物の例証的だが非制限的な例は [以下に列撃するアニオンの例証的だが非制限的な対合イオンとしてトリ (ロープチル) アンモニウムを用いて]、金属カルボランの塩および金属ボランアニオン、たとえばトリ (ロープチル) アンモニウムピス (ノナハイ

ドライド -1・1-ジカルパノナポレート) コパルチート(田)、トリ(a-ブテル) アンモニウム ピス (ウンデカハイドライド -7・8-ジカルパウンデカポレート) フェレート (鉄酸塩) (田)、トリ (n-ブチル) アンモニウム ピス (ウンデカハイドライド -7・8-ジカルパウンデカポレート) コパルチート (田)、トリ (n-ブチル) アンモニウム ピス (ウンデカハイドライド -7・8-ジカルパウンデカポレート) ニッケレート (田)、トリ (n-ブチル) アンモニウム ピス (ウンデカハイドライド -7・8-ジカルパウンデカポレート) キュプレート (頻酸塩) (田)、トリ (n-ブチル) アンモニウムピス (ウンデカパイドライド -7・8-ジカルパウンデカポレート) アウレート (金酸塩) (田)、トリ (n-ブチル) アンモニウム

ピス(ノナハイドライド -7.8-ジメチル-7.8- ジカルパウンデカボレート)フェレート(皿)、トリ(n-ブチル)アンモニウムピス(ノナハイドライド -7.8-ジメチル -7.8-ジメルパウンデカボレート)クロメート(クロム酸塩)(面)、トリ(n-ブチル)アンモニウム ピス(トリプロモオクタハイドライド -7.8-ジカルパウンデカボレート)コパルチート(皿)、トリ(n-ブチル)アンモニウム ピス(ドデカハイドライドがカルパドデカボレート)コパルテート(皿)、ピス [トリ(n-ブチル)アンモニウム] ピス(ドデカハイドライドドデカボレート)ニッケレート(皿)、トリス [トリ(n-ブテル)アンモニウム] ピス(アデカハイドライド・デカルパウ

ンデカボレート)クロメート(皿)、 ピス 【トリ(n-ブ チル) アンモニウム】 ピス(ウンデカハイドライド - 1-カルバウンデカ ポレート)マンガネート( IV )、 ピス 【トリ(n-ブ チル) アンモニウム】 ピス(ウンデカハイドライド - 1-カルバウンデカポレート) コバルテート( II )、 ピス 【トリ(n-ブ チル) アン モニウム】 ピス(ウンデカハイドライド - 1-カルバウンデカポレート)ニッケレート( IV ) 等である。 代数的ホスフォニウム 化合物の 同様な リストも例 証的 第二化合物 として記すことができるが、 簡単にするために、上記アンモニウムー および 置換ホスフォニウム 塩に相当するホスフォニウム および 置換ホスフォニウム 投を本 発明の 第二化合物 ことができることだけをつけ加えておく。

低して、そして上に確認された大部分の第一化合物は上に確認された大部分の第二化合物と結合して活性をレフィン取合触媒を生成することができるが、連続出合をといるという。 とっては最初に形成された金属カチオンか、またはその分解産物かのどちらかが比較的安定なオレフィン理合をはであることが重要である。 第二化合物の酸性度が、必要なプロトン移動を容易にするために十分大きの、必要なプロトン移動を容易にするために十分大きくなければならない。 成る種のメタロセン化合

物 - 例 証的だが 飼服的でない例として ピス (ベンタメチルシクロベンタリエニル) ハフニウム ジメチルを用いる - は、最も強いブレンステッド酸以外のすべてとの反応に抵抗する。したがってここに記載の触螺を形成する ための 第一成分としては適していない。 被して、水性溶液によって 加水分解され得る ピス (シクロベンタジエニル) 全族 化合物 は、ここに記載の 触媒を形成する 第一成分として 適していると考えられる。

本塾明の活性触媒を形成するための所望のカチオンと 安定化イオンとの組み合わせに関して注意しなけらばな らないことは、話性触媒を作るために組み合わせる二つ の成分は、アニオンがモノマーまたはその他の中性リュ イス塩基によって確実に量換されるように選ばれなけら ばならない、ということである。これは、シクロペンタ ジェニル炭素原子上の世換、並びにアニオンそのものへ 世換に起因する立体障害によって行われる。ベルヒドロ カルビル監偽シクロペンタジエニル金属化合物お上び/ またはかさ高の第二成分の使用は概ね所望の組み合わせ を組止しない、そして実際に、低してより不安定なアニ オンを与える。それからさらに、ベルヒドロカルビル筐 換シクロペンタジュニル基から成る金属化合物(第一成 分)は、未置換シクロペンタジェニル基を含む金属化合 物に比べてより広い範囲の第二化合物と共に効果的に用 いられる。攻臨、ベルヒドロカルビル冒換シクロベンタ ジェニル基を含む第一の化合物は、低して、より大きい

アニオンとより小さいアニオン両方を含む第二級分と組分をおっておいて、より有効な対象のはおよび大きさが減るにつれて、より有効な対線がより大きいアニオンを含むで、より有効な対象がより大きいの或らに包含されるもの、および式5でより大きいの値をもつもの。これらの場合、式5に包含される第二化合物を別いるときませり。よりよくであるのがより好ましい。よりも、これをはそれ以上の例数の整数である第二化合物を対域的に、任意なはそれ以上の例数の整数である第二化合物を対域的に不活性にする数性BーHーB部分を有する。

合政階に加える前に、別の設階でその触媒を形成することが行ましい。触媒は自然発火性の種類を含まないが、 触媒成分は水分および酸素の調力に敏感であり、豊業、 アルゴンまたはヘリウムのような不活性環境でとり扱かったり移したりすべきである。

発明者は特定の理論にしばられることを選まないが、 本発明の改良触媒の製造に用いられる二化合物が適した 情報または希釈剤中で結合するとき、第二化合物のカチ オン (プロトン) の会部または一部が全員会有 (第一) 成分上の観視基の一つと結合すると考えられる。第一の 成分が上記の一段式1のそれに担当する式を有する場合、 中性の化合物が避難し、それは溶液中に残るか、ガスと して放出される。この点に関して、第二化合物のカチオ ンがプロトンで、金属含有(第一)化合物のXIかX2 が木雷化物 (hydride) である場合は、水素ガスが遊離す ることに注目しなけらばならない。同様に、第二化合物 のカチオンがプロトンで、X1 かX2 がメチル茹である 場合、メタンがガスとして遊離する。第一成分が一般式 2. 3またはものそれに相当する式を有する場合には、 金属食有(第一)成分上の質換基の一つはプロトン化さ れるが、振して監接基は金銭から遊離しない。金銭会有 (第一) 成分: 第二成分カチオンの比が約1: ]または それ以上になるのが好ましい。如二化合物のカチオンの 共役塩基(conjugate base)は、もしそのような部分が残 っているならば、溶液中に残っている中性化合物がまた は形成された金属カチオンとの錯化合物である、ただし カチオンは綴して、中性共役塩基と金属カチオンとの粒 合が弱いか、または存在しないように、選択される。こ うして、この共役塩基の立体的かさが増えるにつれて、 それは活性触媒を妨害することなく簡単に接渡中に残る。 たとえば、第二化合物のカチオンがアンモニウムイオン であるならば、このイオンは水素原子を遊離し、それは その後水業原子がカチオンであった場合のように反応し てガス状水溝、メタン等を形成し、カチオンの共役塩基 はアンモニヤとなる。同じようにして、第二化合物のカ

チオンが、本発明において必要であるように最低 1 歯の水素原子を含むとドロカルビル関換アンモニウムイオンであった場合、その水素原子は、水素がカチオンである場合と同じように反応し、カチオンの非役塩基はアミンとなるだろう。 さらに、第二化合物のカチオンが本処明に必要であるように最低 1 歯のプロトンを含むとドロカルビル関換ホスフォニンとなる。

特定の理論によってしばられたくはないが、金属含有(第一)成分が第二成分と反応したとき、触媒配位性でいられる第二成分にはじめから含まれていた非配位性でニオンは、形式的には配位数3.a.+4個を有する金属カチオンかまたはその分解生成物と結合し、安定は、動が1つ以上のオレフィン、ジオレフィンをよび/または1つ以上の他のモノマーと一部に接触するときまで、このとうに結合したままでいる。上に記載のように、第二インは、オレフィン、ジオレフィンはきれてはアセチレン性不飽和モノマーによって、第二人の合物に含まれるアニオンは、オレフィン、ジオレフィンはきたはアセチレン性不飽和モノマーによって、が正となってはならない。

上に記載のように、上に列挙した大部分の第一化合物は上に列挙した大部分の第二化合物と結合して抵性触ば、 特に活性な望合触線を生成する。しかしながら異原の活

錐のオレフィン重合触媒は、ピス(ペルメチルシクロペ ンタジエニル)ジルコニウム ジメテルをトリ (a-ブテ ル) アンモニウム 7.8-ジカルパウンデカポレート(12)ま たは1.8-ジカルパウンデカボラン(18)と一緒にし、反応 させることによって作られる。安定な、分離可能のオレ フィン質会験媒は、ピス(エチルテトラメチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウム ジメチルモ1.4-ジカルバ ウンデカポラン(18)と結合させることによっても作られ る。これらの場合の各々において、安定な豊合触媒は、 反応体を約・100℃~約 800℃の範囲内の温度で返した格 雌または雑訳剤に加えることによってつくられた。発明 者が入乎も得るあれやこれやの情報に基づくと、分離可 彼の、特徴づけ可能の重合鉄雄は、ピス(ベルヒドロカ ルビルー世換シクロペンタジエニル)金属化合物を上に 列挙した一つ以上の第二化合物と結合させることによっ ても得られることが明らかであるようにみえる。また、 活性だが分離不能の重合触媒は、各シクロペンタジェニ ル基上にも笛より少ないヒドロカルビル置換基を含むビ ス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム化合物を、ブ ロトン供与性のカチオンと、メタロセンカチオンを安定 させることができ、重合中にオレフィン、ジオレフィン またはアセチレン性不能和モノマーによって置換される ほど十分不安定なアニオンを含む本発明の範囲内の差切 な第二化合物、特により大きいアニオンをもつ第二化合 物と反応させるときにも得られる。

性触媒程は、それを分離し、その後周定するためには必ずしも十分安定ではない。その上、そして最初の企協力チオンの多くが比較的安定である一方、最初に別成された金属カテオンは分解して、活性異合触媒質かまたは触媒的に不活性な種類を与えることが明らかになった。しなし大部分の分解産物は触媒のに活性である。発明者は特定の理論によってしばられることを望んでいないが気管性分解験物を含む、まだ分離されていない活性触媒質は、分離され完全に特徴づけられた活性触媒構と同じをは、分離され完全に特徴づけられた活性触媒構と同じないないが、からのであるが、少くとも、触媒として機能するために必要な構造、たとえば反応性金属一炭素結合を保持する、と考えられる。

特定の艱難によって、しばられたくないが上述したように、シクロペンタジエニル類上の監偽の程度およために質が、特に活性なオレフィン食合触媒を形成するために必要な安定化アニオンの大きさを定めるということも考えられている。この点に関して、メタロセンカチオン中のシクロペンタジエニル基上の置換基の数が5から0になる。こうして、メタロセンカチオンのシクロペンタジエニル基上の置換基の数が5から0へ減るにつれて、より大きいまたは反応性のより小さいアニオンを用いて、
確実に不安定にし、特に活性な触線程を形成せしめなければならない。

前述のことに従えば、安定な、分離可能、特徴づけ可

生する化学反応を、以下に記載される一般式を参照して示す:

8. (4-c<sub>p</sub>) xx' 1 + tt' + tt' + tt' + tt' - tt' - tt' - tt' - t(4-c<sub>p</sub>) xx' 1 x' 1 tt' tt' - tt'

C. (4-C, ) ML+(L' -H) \* (8' ) \* + [(4-C, ) H(LH)]\* (B' ) \* + L'

D.  $(c_p)(\overline{(c_p^*)})(\overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2} + \overline{\alpha_1}^*)(\overline{\alpha_1})^{-1} + \overline{(c_p)}(\overline{(a_{c_p^*})}(\overline{\alpha_2})^{-1})^{-1} + \overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}$  $2 \approx 12 (c_p)(\overline{(a_{c_p^*})}(\overline{\alpha_2})^{-1})^{-1} + \overline{(a_p^*)}(\overline{\alpha_2})^{-1} + \overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}$ 

上記の反応式において、文字A~Dは、有別なメタロセン化合物のための一般式と組み合わせて示される数字1~4にそれぞれ相当する。B'は上の式 5 および 6 に級略示される一般式に一致する適合性イオンをあらわす。4つの野のメタロセンの各々の、N.N-ジメテルーアニリニウムピス(7.8-ジカルパウンデカボレート)コパルテート(皿)との反応を、溶液 『U MMR または 18 C NMR スペクトロスコピーによって試験した。どの場合にも、上に機略示したものと一致する生成物が認められた。

概して、本発明の方法によって形成される安定な分離可能の触媒は溶媒から分離され、その後の使用のために保存されてもよい。しかしながら、分離されない触ばは、最後にオレフィン宣音に用いられるまで、緩ね溶液として保存される。或いは、本発明の方法によってつくられる触媒はいずれもその後の使用のために溶液として保持されるか、試验後直接、重合触媒として使用される。そ

特表平1-501950 (12)

の上、そして上記のように、触様は、値々の成分を登合 容器に通すことによってそのままの場所でつくられても よい。その容器中で抽成分は接触し、反応して本発明の 改良触様を生成する。

概して、そして上記のように、本発明の改良触媒は、 従来のチーグラーーナッタ触媒について先行技術で知ら れる条件で、オレフィン、ジオレフィンおよび/または アセチレン性不動和モノマーをそれだけで、またはその 他のオレフィンおよび/またはその他の不動和モノマー と組み合わせて重合させる。本発明の重合プロセスでは、 分子量は、触媒濃度、重合速度、および重合圧力の関数 であるようにみえる。既して、本発明の触媒で刻造され るポリマーは、水素またはその他の連続停止剤のない空 気中で製造されるときは、末端不飽和を含む。

本発明の触線で製造されるポリマー生成物には、アルミニウム、マグネシウム 進化物等のチーグラー・ナッタ 遊離 様で製造されるポリマーに疑ね認められるいくつかの 競跡 金属は、 もちろんない。 本発明の触線で製造されたポリマー生成物は、アルミニウムアルキルのような金属アルキルを含むより一般的なチーグラー・ナッタ触媒で製造したポリマーよりも広範囲に応用されるはずである。

## **売明の好ましい実施的**

本発明の舒ましい政施例において、飛合触線は第IV-B 該金属の一つのピス(シクロペンタジエニル)化合物、 もっとも評ましくは、二つが独立的に関係された、または関係されないシクロベンタジエニル基および二つの企 級アルキル関係基または二つの水素化物を含むピス(シクロベンタジエニル)グルコニウム、またはピス(シクロベンタジエニル)ハフニウム化合物を、以下に記載のものの一つと結合させることによって扱られる。

(1) 次の一般式を満足するボランまたはカルボランの 三属換アンモニウム塩:

7. [(CH) x (BH) br] CI\*

#### ここで:

B、C および H はそれぞれ 明 紫、 炭紫、 水紫; a x は 0 か 1 : c x は 1 か 2 ; a x + c x = 2 ; b x は 10 から 12までの 軽数。

(2) 次の一般式を満足するボランまたはカルボランアニオンの三直換アンモニウム塩、または中性ボランまたはカルボラン化合物。

#. ((CH) ay (BH) ay Hay) CF

#### 227 :

B、 C、 月 は それぞれ 研 素、 炭素 および 水 素 : a y は 0 から 2 までの 整 数 ; b y は 0 から 3 までの 整 数 ; c y は 0 から 3 までの 整 数 ; a y + b y + c y -4 ; m y は 9 から 18までの 整数。

(1) 次の一般式を選足する金属ポランまたは金属カルボランアニオンの二面換アンモニウム塩。

1. [[(CH) \_ (BH) \_ H \_ ] CT- ] , M2 TT- ] dt-

# 227.

B、C、H、M2はそれぞれ明素、炭素、水素および運移金属;axは0から2までの整数;bxは0から2までの整数;bxは0から1までの整数;az+bz+cz-4;nzおよびdxはそれぞれ2と2、または3と1である。

アンモニウムカチオンの三個換基の各々は、同じかま たは異なる年級アルチルーまたはアリール基である。低 数アルキルとは、1箇から4箇までの炭素原子を含むア ルキル基を意味する。式?によってあらわされるアニオ ンを用いる本発取の最も好ましい実施保では、ピス(ベ ンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメ チルがトリ (n-プチル) アンモニウム l-カルパウンデカ ポレートと結合して、扱も好ましい触媒を生成する。式 8であらわされるアニオンを用いる本発明の最も好まし い実施例では、ビス(ベンタメチルシクロベンタジェニ ル) ジルコニウム ジメチルが 1・1-ジカルパウンデカボ ラン(13)と、結合して、最も好ましい触媒を生成する。 式りによってあらわされるアニオンを用いる本類明の最 も好ましい実施例では、ピス(シクロペンタジュニル) ジルコニウム- または -ハフニウム ジメチルが N.N-ジ メチルアニリニウムピス(1.8-ジカルパウンデカポレー ト) コパルテート (皿) と結合して最も好ましい触媒を 生成する。本処別の好ましい実施例では勉謀を作るのに 州いる二成分が約0℃~約 100℃の温度範囲で貼合する。 それら成分は、好ましくは男香族以化水業指離中で、最も好ましくはトルエン中で結合する。約10秒から約60分までの範囲の公称保持時間は、本発明の好ましい、および最も好ましい触線を作るには十分である。

本発明の好ましい、そして最も好ましい変越的においては、形成直後の触媒を用いて 1 和類またはそれ以上の低級 a - オレフィン、特にエテレンおよびプロピレン、最も好ましくはエチレンを約 0 でから約 100でまでの温度範囲で、約15psig(1.05 kg/cd) ~約 800psig(85kg/cd) の範囲内の圧力で重合する。モノマーは公称保持時間、約 1 ~約80分の間重合条件下に保持され、触媒は、溶媒または特权剤 1 リットルあたり約10 $^{-5}$ ~約10 $^{-1}$ モルの範囲内の適度で用いられる。

こうして本発明およびその好ましい、および最も好ましい実施が様を広く説明したが、同じことは次の実施例を参照することによってさらに明らかになる。しかし、実施例は説明の目的のためにのみ示されるのであって、発明を解除するものでないことは当然である。活性触媒を分離し、確認する実施例では、分析は固体状態の13 C MMR スペクトロスコピーおよび接液 111 NMR スペクトロスコピーおよび接液 111 NMR スペクトロスコピーによって行った。

# 実施例 1

この 裏施例において、活性オレフィン重合触ばは、 1.0 まの ピス (ベンタメチル -シクロベンタジェニル) ジルコニウム ジメチルを50mlトルエン中で結合させ、 それから0.82gトリ(n-ブチル)アンモニウム7.8-ジカルパウンデカボレート(12)を加えることによって作られ、分離された。混合物を富温で80分間投作し、溶解を最初の容量の単分になるまで蒸発させ、ペンタンを、分り点、で加えた。一般 -20℃で冷却した後、双色健体を摂取し、ペンタンで洗い、乾燥した。活性触ばの収益は0.75gであった。この生成物の一部を分析し、ピス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)メチル(ドデカハイドライド-7.8-ジカルパウンデカボレート)ジルコニウムとして確認された。

## 実施例 2

この実施例では、 1.2gの ピス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメチルを 100ml ペンタンに溶かし、それから、 0.3g gの 7.g-ジカルパウン ガガラン(13)を含むトルエン溶液 5 回を液下して加えることによって、活性オレフィン 重合触線を作った。 溶液から明 黄色の固体が比較した。 30分後、 箇体を摂取し、 ペンタンで洗い、 乾燥した。 生成物の収量は 0.95 g であった。 生成物の一部を分析し、 実施例1で生成した同じ活性触媒であるピス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)メチル(ドデカハイドライド-7.g- ジカルパウンデカポレート)ジルコニウムとして確認された。

### 実施例 3

この実施例では、 0.425gのピス(エチレテトラメチルシクロベンタンジエニル)ジルコニウム ジメチルを

反応器から終出させ、反応器を関けた。生成した線状ポリスチレンの収益は74.8まであった。

# 異族例 6

この実施例では、打び、実施例 2 で生成した触媒の一部でエテレンを頂合した、すなわち触媒 75 転を 100 ml クロロペンゼンに溶かし、それを窒素気流下で、あらかじめ監索をどっと彼し込んだ、没作できる別談 類 1 リットルオートクレーヴに移した。オートクレーヴを 150 ps is (10.5 kg/cd) エチレンで加圧し、40でで投拝した。 20分後、反応器から訴出し、反応器を開けた。生成した線状ポリエチレンの収益は 3.8 g であった。

# 

この裏類例では、80mg ピス(ベンタメチルシクロベンタジエニル)ジルコニウム ジメチルおよび 85 mg 1・2-ジカルパウンデカボラン(18)を20ml ジクロロメタンに溶解することによってその場所で生成した活性触線でエチレンを置合した。それから大気条件下でエチレンを溶液中に 1 分間 おくなくと通し、そのスラリーをその後過剰のエチノールに注入した。生成したポリエチレンを摂取し、水とアセトンで洗い、乾燥した。ポリエチレン収量は 1.8 g だった。

# 安培例 8

この実施例では、トルエン(5 ml)中でピス(ペンタ メチルシクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメテル (48mg) をオクタデカボラン(22)(20mg)と反応させる 80回のペンタンに海解し、 0.125gの1.8-ジカルパウンデカボラン(13)を含むトルエン溶液 5 mi を減下して加えることによって活性オレフィン単合触媒が作られた。溶液から明賞色関体が批凝した。15分後、関体を停取し、ペンタンで洗い、乾燥した。生成物の収益は 0.502g だった。生成物の一部を分析し、ピス(エチルテトラメチルシクロペンタジエニル)メチル(ドデカハイドライド1.8-ジカルパウンデカポレート)ジルコニウムと確認した。

#### 32 IN IN A

この裏施例では、実施例 2 で生成した触媒の一部を用いてエチレンを重合した、すなわち、この触媒 5 0 m を 100ml トルエンに指かし、その触媒溶液を延柔気後下で、あらかじめ資本をどっと流し込んだ、資料できる類核製 1 リットルオートクレーヴに移した。そのオートクレーヴを 300psis (21kg/cd) エチレンで加圧し、80でで質拌した。50分後、反応器から排出させ、反応器を関けた。生成した線状ポリエチレンの収量は 22.85 g であった。

この実施例では、実施例 3 で生成した触線でエチレンを重合した、すなわちこの触媒 50 mg を 100 ml トルエンに溶解し、その触媒溶液を窒素気流下で、あらかじめ窒素をどっと吹き込んだ、撹拌できる削鉄製 1 リットルオートクレーヴに移した。オートクレーヴを 400 psig (28 kg ノロ) エチレンで加圧し、40℃で撹拌した。 1 時間後、

ことによって活性性概を作った。かなり多量のガス放出があった。エチレンをその格故に 1 分間過すと、格故は 熱くなった。パイアルを聞け、アセトンを加えるとポリマーが沈頼し、それを抑取してアセトンで洗い、乾燥した。分離されたポリマーの収益は 0.82 g であった。

# 実施例 9

この実施例では、serus-capped丸底フラスコ中で、トルエン ( \$0 ml ) 中でピス ( ペンタメチルシクロペンタグエニル) ジルコニウム ジメチル ( 40 mg ) をトリ ( n-ブチル) アンモニウム トリデカイハイドライド -1-カルパウンデカボレート ( 30 mg ) と反応させることによって活性触媒を製造した。その溶液は無色から複質色になった。エチレンを 1 分間その溶液に通すと、その溶液は無くなり、ポリマーが溶液から沈吸した。

# 夹裤例 以

この実施例では、ヘキサジュウテリオベンゼン1 回中で 50 mg ピス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメチルと 40 mg トリ(nーブチル) アンモニウム 1-カルバドデカボレートを結合させ、その溶液を NMR チューブに入れるという方法で、活性触線が NMRチューブ中で製造された。その後、 1H HMR スペクトロズコピーによって原材料の消失が認められた、そして原料が消失したとき、エチレンを HMRチューブに注入した。固体ポリマーが溶液から沈殿した。

# 実施例 11

この実施例でも、ヘキサジュウデリオベンゼン1 ml 中に 100mg ピス [1.8-ピス (トリメチルシリル) シクロベンタジェニル] ジルコニウム ジメチルおよび 60mg トリ (n-ブチル) アンモニウム1-カルバドデカルボレートを修かし、それからその熔放を NHRチューブに入れるという方法で、活性触媒が NHRチューブ中で製造された。 1 IL NHR スペクトラムで原料の消失が認められた。原料のジルコニウム化合物が全部消失したとき、エチレンをチューブに注入し、固体ポリマーが溶液から沈澱した。 実施例 12

この実施例でも、ヘキサジュウテリオペンゼン 1 al 中に 100g(ペンタメテルシクロペンタジエニル) [1.8-ビス(トリメチルシリル)シクロペンタジエニル) プルコニウム ジメチルおよび Toug トリ (n-ブテル) アンモニウム 1-カルバドデカボレートを溶かし、それからその溶液を NMRチューブ中に入れることによって、活性触縦を HMRチューブ中に形成した。 H<sup>1</sup> NMR スペクトラムによって原料の消失を追跡し、原料ジルコニウム化合物の全部が消失したときエチレンをチューブに注入した。 その後間体のエチレンポリマーが溶液から沈澱した。

この実施例では、serus-cappedパイアル中で、トルエン 7 al 中で 80 mg ピス (ベンタメチルシクロベンタジエニル) ジルコニウム ジメチルおよび 50 mg ピス 【トリ (n-ブチル) アンモニウム】ドヂカボレートを張過させるこ

チレンの収益は0.41gであった。

# **支旋例 18**

異版例 18

この実施例では、serua-cappedパイアルに入れたトルエン (10ml) 中でピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル (40mg) を N・H-ジメチルアニリニウムピス (7・8・ジカルパウンデカボレート) フェレート (皿) と反応させることによって活性触線を製造した。エチレンを接液を通すと、混合物は熱くなり、ポリマーが生成した。パイアルを開け、内容物をアセトンで特釈した。それから伊達し、乾燥した。分離したポリマーの収益は 0.38 g であった。

# **実版例 17**

この実施例では、servs-capped丸底フラスコに入れたトルエン(\$0 ml) 中でピス(ペンチメチルシクロペンチジェール) ジルコニウム ジメチル(40 mg) をトリ(n-ブチル) アンモニウムピス(1.8-ジカルパウンデカボレート) ニッケレート (回)(45 mg) と反応させることによって活性触媒を作った。エチレンを1分間溶液を通した。ポリマーが熔液から沈微するにつれて溶液は熱くなった。フラスコを翻けて内容物をアセトンで発釈した。 図体ポリマーを伊取し、アセトンで洗い、乾燥した。分離ポリマーの収量は0.48 g であった。

# **爽施例** 18

この実施例では、ゴム脳験をかぶせた 250ml丸成フラスコ中の 100mlトルエンに、 100mg ピス (メチルシクロ

とによって活性触媒を設定した。混合すると、懸濁液は無色から質疑色に変った。エテレンを 30秒 間溶液を通すと、溶液が強かくなるにつれて白色ポリマーが生成した。パイアルをあけ、ポリマーをエクノールで沈澱させた。ポリエチレンの収量は 0.13 g であった。

#### 赛艇例 14

この貫旋例ではserus-cappedパイアルに入れたトルエン (5 mi) 中でピス (ペンタメチルシクロペンタジェニル) ジルコニウム ジメチル (45 mi) モトリ (n-ブチル) アンモニウム ウンデカハイドライド・1-カルパワンデカポレート (10 mg) と反応させることによって活性触媒が製造された。 溶液は無色から黄色に変った。 エチレンを 80 秒 間 溶液を通すと、溶液は熱くなり、ポリマーが洗

## **実施例** 15

この表施例では、scrus-cappedパイアル中でトルエン5 叫に 8 0 mg ピス(ペンクメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウム ジメチルおよび 8 0 mg N.N-ジメチルアニリニウムピス(7.8-ジカルパウンデカボレート)コパルチート(皿)を懸滴させることによって、活性触媒を作った。 黄色宿放はガス放出と共に複葉色に変った。エチレンを 3 0 秒 間溶液を過すと、溶液はかなりの熱を放出して深葉色に変り、粘稠になった。パイアルを開け、固体をエタノールで沈載させた。これを 10% 苛性ソーダ水溶液、エタノール、アセトンおよびヘキサンで洗った。ポリエ

ベンタ クエニル) グルコニウム グハイドライドおよび 180mg N・N' - ジメチルアニリニウム ピス (7・8-ジカルパウンデカボレート) コパルラート (皿) を懸滅することによって活性触線をつくった。エチレンを10分間、溶液を通した。フラスコを開け、内容物をヘキサンに注入し、摂別し、乾燥した。ポリマー収費は2.98g であった。

# 实施例 19

この表類例では、ゴム陽線でキャップをした 100ml 丸成フラスコ中のトルエン 50mlに 105mg ピス { 1.8-ピス (トリメチルシリル) シクロペンタジエニル) ジルコニ ウム ジメチルおよび 90mg N.N-ジメチルアニリニウム ピス ( 7.8-ジカルバウンデカポレート) コバルテート ( 皿) を懸調することによって活性触媒をつくった。エ チレンを10分間溶液を通した。フラスコを明け、内容物 をエタノール中に注ぎ、蒸発させた。ポリマーの収益は 2.7gであった。

# 實施例 20

この異様例ではゴム陽脚でキャップした 100al 丸底フラスコに入れたトルエン 50ml 中で、50mg ピス (シクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチルおよび 90mg N.N-ジメチルアニリニウムピス (1.8-ジカルパウンデカボレート) コパルテート (国) を摂控することによって 活性触媒をつくった。エチレンをその溶液を通すと、1分間は明らかな反応は認められなかったが、その後、顕著な

起湖を見ることができた。16分後、フラスコを開け、内容物をエタノールで語訳し、蕗頭させた。ポリマーの収益は 1.9g であった。

#### **支統例 21**

この 皮焼得では、隔膜でキャップした (\*coptum-cappod) 丸匹フラスコに入れたトルエン 50mi 中で 89mg ピス (シクロペンタ ジェニル) ハフニウム ジメチルを 80mg N.N-ジメチルアニリニウム ピス (?.8-ジカルパウンデカポレート) コパルテート (皿) と反応させることによってエチレンを留合した。エチレンを招放を逃すと、30秒後に顕著な 起潮 があらわれ、溶液 は熱くなった。10分後、溶液をアセトンに注入し、ポリマーを提別し、乾燥した。 銀状ポリエチレンの収益は 2.2 g であった。

#### 夹脏例 22

## 夹筋例 23

この実施例では、トルエン種釈剤中でエチレンと1-ブ

/d)エチレンで加圧した。オートクレーヴを50℃で20分間批伴し、その後冷やし、排出させた。内容物を空気気液下で乾燥した。分離ポリマーの収量は75.1gであった。ポリマーの敵点は103℃で、赤外スペクトロスコピーによる分析は、皮素原子100酉につき約29のエチル分はがあることがわかった。

# **爽版例 25**

この真旗例では、 merum-capped丸底フラスコに入れた 25ml トルエン中で 88 mg 1-ビス(シクロベンタジエニル)チタン -8-ジメチル -シラシクロブタンおよび 8 8 mg N. N-ジメチルアニリニウム ビス(1.8-ジカルパウンデカボレート)コパルテート(皿)を反応させることによって、エチレンを重合した。 溶液は、エチレンを通すと風ずんだ。 10分後、フラスコを開け、内容物をエタノールで移択した。 ポリマーを摂到し、エタノールおよびアセトンで洗い、 乾かした。分離ポリエチレンの収益は 0.08 m であった。

# 

この変数例では、serus-capped乳底フラスコに入れたトルエン 20 ml 中で、 81 mg 1-ビス (シクロベンタジエニル) ジルコン -8-ジメチルシラシクロブタンおよび 87 mg N.N-ジメチルアニリニウム ピス (1.8-ジカルパウンデカポレート) コパルテート (皿) を反応させることによってエチレンを資金した。エチレンを溶液を通すと、溶液は温かくなってポリマーが代類した。10分後、パイアルモ

テンを共盛合させた、そのためには、50mg ピス(シクロペンタジェニル)ジルコニウム ジメチルおよび 45mg N.N-ジメチルアニリニウム ピス(1.8-ジカルバウンデカボレート)コバルテート(国)からそのままの場所でつくられた勉強を含むトルエン溶液 85mlを、窓 素気流下で、あらかじめ 窒素を凝し込んだ、乾燥、無酸素トルエン 400mlを含む 1 リットル、ステンレス網 製オートクレーヴに加えた。1-ブテン(200ml)をそのオートクレーヴに加え、それをさらに 120pmlg(7.18kg/cd)のエチレンで圧をかけた。オートクレーヴを50℃で30分間投作し、それから冷やし、(ガスを)排出させた。内容物を空気流下で乾燥した。分離したポリマーの重量は44.7gであった。ポリマーの磁点は 117℃で、亦外スペクトロスコピーによる分析の結果、1000炭素原子あたり、約17のエチル分枝があることがわかった。

#### 災益例 24

この実施到では、70mg ピス(シクロペンタジエニル)ハフニウム ジメチルおよび 45mg N.N-ジメチルアニリニウム ピス(7.8-ジカルバウンデカボレート)コバルナート (皿) を含む触体 トルエン溶液 50ml を、あらかじめ 20mg を放し込んだ、 400ml 乾燥、 無 歳水 トルエンを含む 1 リットルーステンレス 斜 数オートクレー・ヴに、 20mg で 加えるという方法で、 エチレンと 1-ブテンをトルエン 稀 収 使 中で共譲合きせた。 1-ブテン (200ml) をオートクレーヴに加えた、それをきらに 120ps 1g (7.18 kg

明け、内容物をエクノールで稀釈した。 沈瀬を伊刻し、エクノールで洗い、 乾燥した。 分離したポリエチレンの収量は 1.41 g であった。

# 爽 栋 例 21

この実施例では、aerus-cappod比比フラスコに入れたトルエン 20 ml 中で 82 ml - ピス (シクロベンタジエニル) ハフナー3-ジメチルシラシクロブタンおよび 88 mg N. N-ジメチルアニリニウム ピス (1.8-ジカルパウンデカボレート) コバルチート (皿) を反応させることによってエチレンを留合させた。エチレンを格被を避すと、ポリマーが沈澱し、溶液は熱くなった。 5 分後、フラスコを開け、内容物をエタノールでうすめた。ポリマーを抑別し、エタノールで洗い、乾燥した。分離したポリエチレンの収益は1.54gであった。

# 

この実施例では、aerus-cappadびんに入れたトルエン50ml 中で 87 eg ピス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(2,8-ジメチル -1.3-ブタジエン)および 8 8 eg N, N-ジメチルアニリニウム ピス(7.8-ジカルパウンデカボレート)コパルテート(皿)を放応させることによってエチレンを重合した。エチレンを溶液を過すと、溶液は徐々に温かくなった。15分後、びんを開け、内容物をエタノールで稀釈した。ポリマーを抑制し、エタノールで洗い、乾燥した。分離したポリマーの収益は 1.87 g であった。

# 特表平1~501950 (16)

## **実裁例 29**

この実施例では、serum-cappedびんに入れた50mlトル エン中で40mg ピス (シクロペンタジエニル)ハフニウム (2.8-ジメチル -1.8-ブタジエン) を 43 mg N.N-ジメチル アニリニウム ピス(7.8-ジカルパウンデカボレート) コパルテート(耳)と反応させることによってエチレン を取合した。エチレンを溶液を通した、溶液は30秒以内 に設備した。20分後びんを開け、内容物をエタノールで 希訳した。国体ポリマーを追別し、エタノールで洗い、 乾燥した。分離したポリエチレンの収益は0.48gであっ t. .

## 実経例 80

この異版例では、 serum-capped丸匠フラスコに入れた トルエン20ml中で55mg(ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) (テトラメチル -エタ<sup>1</sup> - メチレン -エタ<sup>5</sup> - シ クロベンタジエニル)ジルコニウム フェニルおよび45 eg N · N-ジメチルアニリニウム ヒス(T · 8-ジカルパウン デカポレート) コパルチート (皿) を反応させることに よってエチレンを重合させた。エチレンを溶液を消すと、 ほとんど瞬時にポリマーが生成し、多益の熱が放出され た。 5 分後、フラスコを開け、内容物をエタノールで様 釈した。沈殿物を抒別し、アセトンで洗い、蛇頭した。 分離したポリエチレン収益は0.55gであった。

## 實施例 31

この実施術では、 serua-cappedびんに入れたトルエン

る。この理由から、本発明の真の範囲を定める目的のた めには、私付の特許は次の顧問のみを参照すべきである。

50ml中で80mg (ペンタメチルシクロペンタジェニル) (ナトラメチルシクロペンタジエニルメチレン) ハフニ ウム ベンジルおよび 60 ag N・N-ジメチルアニリニウム ピス(1,8-ジカルパウンデカポレート)コパルテート (皿)を反応させることによってエチレンを垂合させた。 エチレンを10分間その溶液を通した。溶液が温かくなる につれてポリマーが北級した。びんを捌け、内容物をエ タノールで稀釈した。固体ポリマーを抑別し、アセトン で洗い、乾かした。分離したポリエチレンの収益は0.92 8 であった。

## 实 旋 例 32

この実施例では、10mlトルエン中で0.42g ピス(トリ メチルシリルシクロペンタジエニル) ハフニウム・ジェ ナルモ G. OB g N. N-ジメチルアニリニウム ピス (7.8-ジ カルパウンデカボレート) コパルチート (皿) と反応を せることによってエチレンを宣合した。この溶液の一部 (0.4ml) をイソパール (1sopar)の 3000パール (1059kg y/ ci) の圧力下で、エチレンで1500パール(1580kg v/ci) に加圧されたオートクレーヴに注入し、 180℃に加熱し た。5秒後、オートクレーヴから内容物を出した。近位 平均分子型144.800 、分子型分布 2.8をもつ線状ポリエ チレン(2.1g) が分離された。

本発明を、その特別の契維整様を撃敗して記述し、説 明したが、熟練せる当業者は、ここに必ずしも説明され ていない変更にも同じことが有効であることを理解でき

#### # 条<del>严</del> 7借 ıΕ

昭和63年12月7日

特許庁長官

1 事件の表示

国際出職新号 PCT/US88/00222

2 発明の名称

触媒、これらの触媒の製法およびこれらの触媒を使用する 重合プロセス

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

エクソン・ケミカル・パテンツ・インク 名称

4 代 理 人

住 所 東京都千代田区永田町1丁自11番28号

相互永田町ビルディング 8階 電話 581-9371 (7101)弁理士 山 崎 行 道 氏 名

(8821) 弁理士 生 Ħ

氏 名 (7603) 弁連士 木 村

氏 名 (9444) 弁理士 竹 俊 子 5 補正命令の自付

昭和

補正の対象

タイプ印書により浄象した明和書及び請求の範囲の翻訳文。

雑正の内容

別紙のとおり



10 P



This sense like the passes family members evaning to the partic documents sixed in the above-tentionod international assess to The summers we to complete a tra European Fasses Often (DP the so copyriges

Parama documenta crical an occurate respons	Publicusion data	Pare are	ni femily mineral	Publication
EP-A- 0200351	05-11-86	JP-A- US-A- JP-A-	61221207 4704491 62121710	01-10-86 03-11-87 03-06-87
US-A- 3211591		None		
			·	
			•	
	•			

		<b>x</b> * 5				
		International Paintings No.	PCZ/UB 08/50222			
- COLOR	IN MICHAELERS PERSON CAMPAGNAMA (FPC) - 10 PROPORTION	name Chardenan one of C				
	C DE T 4/64; C DE T 4/76;		- 17/00			
		C 04 2 10/00; C 07	7 17/00			
4. FILE	ENA PENER					
· ************************************	on Sestion	Militar Sadding !				
		Coordinate Symmetry				
zec <sup>4</sup>	C 08 F; C 07 F		1			
	Documentation Searched other to the Eastern Pel agest Document	MAX SECURITY DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE				
		i				
IG. BOCK	MENTS CONSIDERED TO DE RELEVANT					
grassa .	Edition of Decument, " sech Microprope, where an	programa, of the four-old seasons to	( Patriot in Claim Inc. 48			
l _ ```			1			
^	Journal of the Chemical Communications, 1986 M. Bothmann et al.:	Society, Chemical  Synthesis and	1 1			
	insertion reactions		1			
	alkylbis(cyclopenta)		1			
	complexes", pages 16	110-1611	1			
	see the whole abstra		1			
	cited in the application	1	1 1			
	EP, A, 0200351 (MITSUI )	PTPOGIEW)	1 1			
•	5 November 1986	PE I ROCHEM)	1 * 1			
	see the whole docume	nat .	1			
	cited in the application		1 1			
λ .	US. A. 3711503 (W. HEFNY	72 er el l	1 1			
,-	US, A, 3231593 (W. HAFNE 25 January 1966	,	1 - 1			
	see claims, column i	, line 71 -	1			
i	column 7, line 7; ex		1			
		•••				
			1			
			[			
	i criegaries of extended extended in	T too section pushing the	to morepared May 4110			
.7, 600		at a track and the test in the				
T 22	d the a between his bringing on h ten be assessed	"I" assumed at sometime record				
"I describe which may those south or proving the first or proving or proving on proving on proving or proving						
_ =	program which may likely doubts on proving plants; or on as eater to proving the point proving of proving that or solver appears measure (to specified)	The description of particular related particular per communicate strategies description of communication and and particular and particular particular particular strategies particular particular particular strategies particular particular particular strategies particular particular particular strategies particular particular strategies particular strategies particular particular strategies particular particular particular strategies particular strategies particular particular strategies particular strategies particular strategies particular particular strategies particular strategies particular str				
·	and History is at any dedicary, and makes in	Secured of Ex-dense with the	P			
	unter publicated gran to the international filtry para but I then the enterty only bushell	"A" DESIGNATE PROPERT OF THE MARKS				
		*				
	Adul Composit of the Improperty Boom	Dro of Wanter of the Improvement &				
	th April 1988		9 MAY 1988			
-	or Bernaring Australia	Bergere St Ausgen Bless				
	EUROPEAN PATENT OFFICE	CN Alexander	TVAN DER PUTTEN			
25741	ANTE FAMORE COME LABOUR 1998					

特許法第17条第1項又は第17条の2の規定 による補正の掲載

昭和63年特許願第501758号(特表平 1-501950号、平成 1年 7月 6日発行公表特許公報)については特許法第17条第1項又は第17条の2の規定による補正があったので下配のとおり掲載する。

Int.C	1.*	職別 配号	庁内整理番号
COSP	4/642	MFG	8319-4J
COTF	17/00		9155-4H
CO8F	10/00		
			i

明細書中特許請求の範囲を次のように打正する。 『特許請求の範囲

1. 次の一般式

(A-Cp)MX,B

によってあらわされ、

ここで:Mはチタニウム(Ti)、ジルコニウム(Zr)および

ハフニウム(Bf)から成る群から選択される金属で: (A-Cp) は (Cp) (Cp<sup>\*</sup>) またはCp-A'…Cp<sup>\*</sup>で、CpとCp<sup>\*</sup>は同じかまたは長なる 運換ーまたは米壁鏡のシクロペンタジエニル紙で: A' は溶IV-A級元常を 含む共有結合保頓基であり; X<sub>1</sub>はハイドライド基、ヒドロカルビル基、有 機メタロイド基等から成る群から選択され、B' は次の一般式

[(CX),(BX'),X',] --

ここで、BおよびCはそれぞれ根索および炭素;

X、X' およびX' はハイドライド墓、ハリド墓、ヒドロカルビル蓋、育機メタロイド基等から成る群から独立的に選択される蓋で;

a およびりは≥0の整数で; c は≥1の整数; a + b + c は2から約8までの 偶数の整数; m は5から約22までの範囲の整数;および

[[[(CX;), (BX;), (X;), ] - ], K\*"]\*"

ここで、B、C およびMはそれぞれ開業、故葉および運移金貨;  $X_1$ 、 $X_2$ および $X_3$ はハイドライド番、ハリド基、ヒドロカルビル落、有機メタロイド基等から成る群から独立的に選択され; a' およびり'は同じか異なる $\geq 0$ の整数; c' は $\geq 2$ の整数; a' + b' + c' は4から約8までの偶数の整数; n' は $\delta$ から約12までの概数; nは $\delta$ 2c' - n - d e2 なるような整数; e4 は e1 の整数である;

のうちの一つの式によってあらわされる適合性非配位性アニオンである化合 物を含む物質組成物。

2. (A-Cp) がピス (ペルアルキル関係ーンクロペンタジエニル)で、Xがアルキル基で;B'が(ドデカハイドライド-7、8-ジカルパウンデカボレート)で、Mがジルコニウムであり、ペルアルキル関換シクロペンタジエー

平成 7.8.18 発行

**戶 続 树 正 害** 

平成 7年 1月27日

特許庁長官 酚

**(E)** 

1 事件の表示

昭和63年特許顯第501758号

2 発明の名称

触媒、これらの触媒の製造およびこれらの触媒を使用する電台プロセス

3 知正をする者

事件との関係 特許出額人

名 称 エクソン・ケミカル・パチンツ・インク

4 代理人

住 所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号 相互永田町ビルディング8階

**革括 3581-987**[

氏名 (7101) 弁難士 山 崎 行 進 (デ 周 所

氏名 (7603) 弁理士 木 村



5 招義理由運知の日付

平成 年 月 日 6 補正の対象

胡求の範囲。

7. 補正の内容

別紙のとおり。



ニル基の各アルキル基が独立的に C,-C, アルキル基で、アルキル群は C,-C,-アルキル基で、ベルアルキル屋換差は行ましくはペンタメチルま たはエチルテトラメチルで、アルキル基は行ましくはメチル裏である時次項 1 に記載の物質組成物。

- 3. (a) 薄した溶媒または活射剤中で、プロトンと反応できる最低一つの置換 基を含むピス (シクロペンタジエニル) 会議化合物から成り、前記会員が チタニウム、ジルコニウムおよびハフニウムから成る野から選択される最 低一つの第一化合物および、プロトンを与えることができるカチオンと、 複数の研索原子を含む、かさ高で不安定で、二化合物間の反応の結果生成 する金属カチオンを安定化することができるアニオンとから成る最低一つ の第二化合物を一緒にし、
- (6)第二化合物のカチオンによって提供されるプロトンが前配金属化合物に 含まれる前配置換蓋と反応するのに十分な時間、象敵(a)で接触を保持し、
- (c) 段階(b)からの庫接生成物として、または1つまたはそれ以上の前配値 接生成物の分解重物として、活性触線を固収する。

趙段階から成る、触媒の製法。

4. 前紀ピス (シクロベンタジエエル) 金属化合物が次の一級式によって表され:

(A-Cp) NX, X,

(A-Cp) NI' , I' 2

(A-Cp)MLおよび/または

(Cp<sup>‡</sup>) (CpR) IX

2 圏の低級アルキル屋換基または2 館のハイドライド、有機メタロイド基等 から成る群から独立的に選択され; X',およびX',は金属原子に結合して会 属サイクルを形成し、ここでは金属、X',およびX',は約3乃至約20の炭素 原子を含む炭化水素理を形成し; R は、やはり金属原子に結合したシクロペ ンタジエニル基の一つの上にある屋換絵である、端水項3に配載の方法。

#### 5. 前記第二化合物が、次の一般式

[L'-H][(CX) \* (BX') \* X' \*] "

4に配着の方法。

ここで、L'ー日は出'、アンキニウムまたは、ヒドロカルビルまたは度換 ヒドロカルビル基で配換される 3 物までの水溶原子をもつ重換アンキニウム 鉱、ホスフォニウム、またはヒドロカルビルまたは置換ヒドロカルビル基に よって 3 簡までの水素原子が置き された超換ホスフォニウム基等であり: B およびではそれぞれ研索および飲まであり: X、X' およびX' はハイドライド誌、ハリド語、ヒドロカルビル語、有職メタロイド語等から成る野から 独立的に選ばれる語であり; a お。び b は ≥ 0の要数で; c は ≥ 1の要数; a + b + c = 2から約8までの偶数の 氢 数: m は5~約220 範囲の整数である; およびノまたは

6. 段階(a)の接触が約-100℃~約300℃までの範囲の温度で、好ましくは0~

46.000psig(0~2847ikg/of)の圧力下で行われる精水項3万重5のいずれかに 記載の方法。

### 7. 第二化合物が一般式

[L'-H][(CH)""(BH)""]...

によってあらわされ

ここで、L'ーHはH、アンモニウムまたは、ヒドロカルビルまたは屋袋 ヒドロカルビル基で3簡までの水素原子が複接された、任意に三屋装された 電換アンモニウム基、ホスフォニウム、またはヒドロカルビルまたは置鉄ヒ ドロカルビル基で3簡までの水業原子が優接された屋袋ホスフォニウム基等 であり、B、CおよびHはそれぞれ観案、投業、および水業で;axは0か1 で;cxは2か1であり;ax+cx=2;bxは10から12までの髪数である、 請求項3万至6のいずれかに記載の方法。

8. 前記第二化合物がピス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] ドヂカポレート およびトリ (n-ブチル) アンモニウム1-カルパウンデカまたは1-カルパドヂ カポレートから成る群から選択され、前記第一化合物がピス (ペンタメチル シクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、(ペンタメチルシクロペ ンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチル、起よび 「1.3-ピス (トリメチルシリル) シクロペンタジエニル」 ジルコニウム ジ メチルから成る群から選択される精液項7に配盤の方法。

# 9. 前記第二化合物が次の一般式によってあらわされ:

[L'-H][(CH), (SH), Sh. ] " "

ここで、L'ーHはH、アンモニウムまたは、3簡までの水素がヒドロカルビルまたは種換ヒドロカルビル基によって産換された、任意に三便換された風換アンモニウム基、ホスフォニウムまたは3間までの水素がヒドロカルビルまたは煙換ヒドロカルビル素によって健挽された産機ホスフォニウム基等であり。B、C、Hはそれぞれ研索、炭素および水魚で;ayは0から2までの整数;byは0から3までの整数;cyは0から3までの整数;ay+by+cy=4;そしてmyは3から18までの整数である、請求項3から請求項6までのいずれかに記載の方法。

- 10. 前配第二化合物がトリ (n-ブチル) アンモニウム7,8-ジカルパウンデカボレートおよびトリ (n-ブチル) アンモニウムトリデカハイドライド-7-カルパウンデカボレートから成る群から選択され、この場合第一化合物が好ましくはピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチルであり、かつ/されたはレ'ーHがH\*、より好ましくは7.8-ジカルパウンデカボラン(13)またはオクタデカボラン(22)であり、この場合任意に前配第一化合物がピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチルおよびピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチルから成る群から選択される解水項 9 に記載の方法。
- 11. 前記第二化合物が次の一般式によってあらわされ:

[L'-E][[((CE)..(BE)...E.,] -- ]; #Z-\*-] \*\*-

ここで、1.7 - 日は日、アンモニウムまたは3箇までの水素原子がヒドロカルビルまたは置換とドロカルビル甚で置換された置換アンモニウム基、ホスフォニウム、または3箇までの水素原子がヒドロカルビルまたは置換ヒドロカルビルまたは置換された置換ホスフォニウム基等であり; B、C、日およびM 2 はそれぞれ研索、炭素、水素および運移金属であり; a s は 0 から2 までの整数; b s は 0 から2 までの整数; c s は 2 か3; m s は 9 から11までの整数; a s + b s + c s - 4; n s および d s はそれぞれ 2 と2、または3 と1 である、前求項3 乃至請求項6 のいずれかに記載の方法。

12. 前記第二化合物が利ドージメチルアニリニウムビス(ウンデカハイドライド
-7.8-ジカルパウンデカポレート)コパルテート(軍)であり、かつ/また は前記第一化合物が1-ビス(シクロペンクジエニル)チタナ-8-ジメチルシ ラシクロブタン、1-ビス(シクロペンクジエニル)リルコナ-3-ジメチル ラシクロブタン、および1-ビス(シクロペンタジエニル)ハフナ-3-ジメチ ルシラシクロブタン、ビス(シクロペンタジエニル)ツルコニウム(2.3ジ メチル-1.3.-ブタジエン)およびビス(シクロペンタジエニル)ハフニウム (2.3-ジメチル-1.3-ブタジエン)およびビス(シクロペンタジエニル)ハフニウム (テトラメチルシクロペンタジエニル) び (ペンタメチルシクロペンタジエニル) (チトラメチルシクロペンタジエニルメチレン) ハフニウムペンジルから成る鮮から選択され;または第二化合物が8,8-ジメチルアニリニウム ビス (7.8-ジカルパウンデカポレート) ニッケレート (国) および8,8-ジメチルアニリニウム ビス (7.8-ジカルパウンデカポレート) フェレート (国) でこの場合好ましくは第一化合物がビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ジメチルである情味項1.1 に貯蔵の方法。

- 13. 2万至約18の炭素原子を含むα-オレフィン、ジオレフィンおよび/または アセチレン性不適和化合物を、単独で、または1種類またはそれ以上のモノマーと組み合わせて、賃含する方法であって、
  - (a) 約-100でから約300でまでの範囲内の程度、約0から約45,000paig(0~28471 kg/cd) の範囲内の圧力で、オレフィン、ジオレフィンおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーを、単独で、または1種類かそれ以上のモノマーと組み合わせて適当な担体、済盛または希釈剤中で、前求項3乃至12のいずれかに記載の方法によって、あらかじめ製造した。裏いはその場で製造した触媒と、宣合の関接触させ、
- (b) 設階(a)の接触を少くとも上記オレフィンの一部が賃合するのに十分な 時間継続し;
- (c) ポリマー生成物を固収する

段階からなる重合方法。

- 14. 請求項3乃差請求項12のいずれかに記載の方法により製造される触媒。
- 15. 請求項13の方法にしたがって製造されるポリオレフィン。
- 16. 第1V-B 協会属の加水分解可能なピス (シクロベンタジエニル)会属化合物または触媒的に潜性なその分解生成物から誘導されたカチオン、および複数の研究原子を含み重合中にオレフィン、ジオレフィン、および/またはアセチレン性不能和モノマーで電換されるのに十分なほど不安定である安定化アニオンを含むイオン性重合施媒。」